

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成26年9月4日 (2014.9.4)

【公表番号】特表2013-532513(P2013-532513A)
 【公表日】平成25年8月19日 (2013.8.19)
 【年通号数】公開・登録公報2013-044
 【出願番号】特願2013-520764(P2013-520764)
 【国際特許分類】

A 6 1 B 18/12 (2006.01)

A 6 1 N 1/06 (2006.01)

【F I】

A 6 1 B 17/39

A 6 1 N 1/06

【手続補正書】
 【提出日】平成26年7月15日 (2014.7.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

患者の治療部位の外観を変更するためのシステムであって、該システムは、

患者の皮膚の表面の外観に影響を与えるのに十分にターゲット組織を変更するように治療部位のターゲット組織から熱を除去するように構成された治療デバイスを含み、該治療デバイスは更に、該治療デバイスにより熱が除去されることによる損傷から非ターゲット組織を保護するように、ターゲット組織から熱を除去する間に治療部位の非ターゲット組織に熱を送出するように構成されている、システム。

【請求項 2】

前記治療デバイスは、治療部位の皮下層の繊維中隔を選択的に加熱するようにエネルギーを供給し、かつ、前記治療部位の皮下層の脂質リッチ小葉の数及び / 又は大きさが所定程度まで減少するが、前記加熱される繊維中隔と隣接した非脂質リッチ細胞及び脂質リッチ領域の数又は大きさが前記程度まで減少しないように熱を除去し、これによって患者の皮膚の表面の表面凹凸を減少するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

前記治療デバイスのために高周波エネルギーを発生することができる高周波発生器を更に含み、前記治療デバイスは、患者に高周波エネルギーを供給するための電極と、患者から熱を除去する 1 つ以上の熱交換ユニットと、を含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記治療デバイスと連通した治療ユニットを更に含み、前記治療デバイスに送出手のためにクーラントを収容する流体チャンバを含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 5】

前記治療デバイスに作動的に結合され、該治療デバイスに、該治療デバイスに熱連通した患者の皮膚を冷却するようにターゲット組織から熱を除去させ、かつ、非ターゲット組織から皮膚を通してエネルギーを供給させる指令を有する制御装置を更に含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

ターゲット組織の皮下細胞を 10 未満の温度に冷却するようにターゲット組織から熱

を除去するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 7】

前記治療デバイスは、高周波エネルギー、光学的エネルギー、音響エネルギー、赤外線エネルギー、および / またはマイクロウェーブのうちの 1 つ以上を治療部位に印加するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 8】

前記治療デバイスがターゲット組織から熱を除去する間に、前記治療デバイスに、非ターゲット組織にエネルギーを定期的を送出させる指令を有する制御装置を更に含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 9】

ターゲット組織の皮下層の脂質リッチ細胞の数及び / 又は大きさが所定程度まで減少するが、非ターゲット組織の細胞の数又は大きさが前記程度まで減少しないように、前記治療デバイスに、ターゲット組織の皮下層の脂質リッチ細胞を冷却させる指令を有する制御装置を更に含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 10】

前記治療デバイスは、患者の皮膚の表面の表面凹凸が減少されるようにターゲット組織を冷却するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 11】

前記治療デバイスは、患者の皮膚が平坦化されるようにターゲット組織を冷却するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 12】

前記治療デバイスは、約 - 20 から約 10 の範囲で患者の皮膚に冷却温度を印加するように構成されている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 13】

前記治療デバイスは、繊維中隔を選択的に加熱する周波数の高周波エネルギーを送出する、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 14】

前記治療デバイスに、約 1 分から約 20 時間、約 1 分から約 1 時間、約 1 分から約 50 分、約 1 分から約 40 分、または約 1 分から約 20 分の間の総高周波エネルギー送出時間に亘って高周波エネルギーを送出させるように構成された制御装置を更に含む、請求項 1 に記載のシステム。